(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-281018

(43)公開日 平成7年(1995)10月27日

(51) Int.Cl. ⁶	5/20	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 2 B	•	2			
C 0 9 B	69/00	PTE			
C 0 9 D	11/00	505			
G03F	7/004	505			
	7/022			審査請求	未請求 請求項の数8 OL (全 6 頁)
(21)出願番号		特願平6-68674		(71)出願人	000002093
					住友化学工業株式会社
(22)出願日		平成6年(1994)4月	月6日		大阪府大阪市中央区北浜 4 丁目 5 番33号
				(72)発明者	
					大阪府大阪市此花区春日出中3丁目1番98
					号 住友化学工業株式会社内
				(72)発明者	山本 茂樹
					大阪府大阪市此花区春日出中3丁目1番98
					号 住友化学工業株式会社内
				(72)発明者	• •
					大阪府大阪市此花区春日出中3丁目1番98
					号 住友化学工業株式会社内
				(74)代理人	弁理士 久保山 隆 (外1名)
				<u> </u>	

(54)【発明の名称】 ポジ型レジスト組成物

(57)【要約】

【目的】 塗布性、色調及び解像度等の賭性能に優れた ポジ型レジスト組成物を提供する。

【構成】 水素原子が1個置換されたスルホンアミド基を有する化合物、アルカリ可溶性樹脂、キノンジアジド化合物、及び主成分として乳酸エステルを含有するレジスト溶剤を含むことを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【効果】 上記レジスト溶剤は上記の置換スルホンアミド基を有する化合物の良溶剤であり、又、当該化合物が色素であっても上記レジスト組成物はその経時安定性に優れているから、賭性能に優れたカラーフィルターを与える。

【特許請求の範囲】

【請求項1】水素原子が1個置換されたスルホンアミド 基を有する化合物、アルカリ可溶性樹脂、キノンジアジ ド化合物、及び主成分として乳酸エステルを含有するレ ジスト溶剤を含むことを特徴とするポジ型レジスト組成

1

【請求項2】水素原子が1個置換されたスルホンアミド 基を有する化合物が下式

-SO2 NH-R

(Rはアルキル、シクロアルキル、アルキルカルボニル 10 アミノアルキル、アルキルカルポニルアミノ、シクロヘ キシルアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、ア リール、アラルキルもしくはアルキルカルボニルオキシ 基を表わす。)で示される基を有する化合物である請求 項1に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項3】式 -SO2 NH-R (Rは請求項2に記 載の意味を表わす。) で示される基を有する化合物がシ アン、マゼンタ又はイエロー色素である請求項2に記載 のポジ型レジスト組成物。

【請求項4】乳酸エステルが乳酸エチルである請求項1 20 ~3のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項5】補助成分としてN, N-ジメチルホルムア ミドを含有するレジスト溶剤を含む請求項1~4のいず れかに記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項6】さらに、塗布性改良剤を含む請求項1~5 のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項?】キノンジアジド化合物がoーナフトキノン ジアジドスルホン酸エステルである請求項1~6のいず れかに記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項8】さらに、架橋剤を含む、請求項1~7のい 30 G-J-M' ずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は特に固体撮像素子、遮光 膜及びセンサー等の用途に用いられるポジ型レジスト組 成物に関する。

[0002]

【従来の技術】CCD 及びLCD 等の固体撮像素子に用いら れているカラーフィルターには3原色又は3補色系の色 素が使用されており、これらの色素は固体撮像素子の良 *40* 好な色再現性や画像再現性を得るために欠かせないもの である。カラーフィルターの製造法として近年試みられ ているレジスト組成物を用いる方法でも、色素がレジス ト溶剤に充分な溶解度を有しないので濃色のレジスト組 成物を得ることが難しく、さらに、レジスト溶剤及び色 素等の組合せによっては組成物の経時安定性が悪くなる という問題点がある。このように、従来のレジスト組成 物は種々の問題点を有している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記問題点を 解決して、経時安定性、塗布性、色濃度及び微細度等の 諸性能に優れたポジ型レジスト組成物を提供する。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、水素原子が1 個置換されたスルホンアミド基を有する化合物、アルカ リ可溶性樹脂、キノンジアジド化合物、及び主成分とし て乳酸エステルを含有するレジスト溶剤を含むことを特 徴とするポジ型レジスト組成物である。

【0005】水素原子が1個置換されたスルホンアミド 基を有する化合物としては、例えば下式

-SO2 NH-R

(Rはアルキル、シクロアルキル、アルキルカルポニル アミノアルキル、アルキルカルポニルアミノ、シクロへ キシルアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、ア リール、アラルキルもしくはアルキルカルポニルオキシ 基を表わす。) で示される基を有する化合物等が挙げら れる。上式で示される基を有する化合物としては、例え ばシアン、マゼンタ又はイエロー色素等が挙げられる。 シアン色素としては、例えば下式

 $(SO_3 M)_h - [Pc] - (SO_2 - NH - R)_i$

(式中、Pcはフタロシアニン核を表わし、h及びiは各 々SO₃M及びSO₂-NH-Rの平均置換数を表わし、Rは上記と 同じ意味を表わし、SO₈Mはスルホン酸基又はスルホン酸 塩を表わすが、h及びiは各々h+i≤4であり、h≤ 3 であり、且つ $i=1\sim4$ を満足するものとする。)で 示される色素等が挙げられる。イエロー色素としては、 例えば一般式(I)

(I)

〔式中、M'は下式

[0006]

【化1】

【0007】〔式中、R1~Rs は各々独立して水素原 子、アルキル基、ハロゲン原子、スルホン酸基、スルホ ン酸塩又は-SO2-NH-R (Rは上記と同じ意味を表わす) 基を表わすが、R1 ~R3 の中少なくとも1つは-SO2-NU-Rを表わす。) で示される基を表わし、Jは下式

[0008]

【化2】

特開平7-281018

(3) 3

【0009】(式中、R4~R12は各々独立して水素原 子、アルキル基、ハロゲン原子、スルホン酸基、スルホ ン酸塩又は上記-SO₂-NH-Rを表わす。)で示される架橋 基を表わし、Gは上記のM'、水素原子、或いは置換さ れていてもよいフェニルアゾフェニル、ナフチルアゾフ ェニル、フェニルアゾナフチルもしくはナフチルアゾナ フチル基を表わし、Rは上記と同じ意味を表わす。〕で 示される色素等が挙げられる。マゼンタ色素としては、 例えば一般式(II)

[0010] [化3]

$$R_{11}$$
 R_{12}
 R_{13}
 R_{14}
 R_{14}

【0011】〔式中、R13~R16は各々独立して水素原 子、置換されていてもよいアルキル又はアリール基を表 わし、R11~R19は各々独立して水素原子、置換されて いてもよいアルキル又はアリール基、スルホン酸基、ス ルホン酸塩或いは-SO2-NH-R(Rは上記と同じ意味を表 わす)を表わすが、 $R_{13} \sim R_{16}$ で表わされるアリール基 の置換基、並びにR17~R19の中少なくとも1つは上記 -SO₂-NH-Rを表わす。〕で示される色素等が挙げられ る。好ましいRとしては、例えば下式

- Cs H2s+1
- Cs H2s+1 OC1 H21
- Cs H2s+1 O
- Cs H2s+1 CONHC1 H21

(式中、s及びtは各々1以上20以下の整数を表わす が、s+t≤30である。) 等で示される基が挙げられ る。上記の水素原子が1個置換されたスルホンアミド基 を有する化合物は、例えばC. I. Acid Colour 及びC. I. Di rect Colour 等に記載の染料から選ばれる色素をジメチ ルホルムアミド中で塩化チオニルと反応させて相当する 50

スルホニルクロリドを得、次いで当該スルホニルクロリ ドを式 RNH2 (Rは上記と同じ意味を表わす。)で 示される1級アミンと反応させることにより、容易に製 造することができる。

【0012】レジスト溶剤の主成分である乳酸エステル としては乳酸エチル及び乳酸メチル等が好ましい。好ま しいレジスト溶剤としては、例えば補助成分としてN, Nージメチルホルムアミド等を含有する溶剤が挙げられ 20 る。主成分である乳酸エステルと補助成分との好ましい 割合は重量比で100 : 0~50:50であり、より好ましい 割合は95:5~55:45である。本発明のポジ型レジスト 組成物はさらに、塗布性改良剤を含んでいてもよい。好 ましい塗布性改良剤としては、例えば変性シリコンオイ ル及びシリコン系界面活性剤等が挙げられる。好ましい 変性シリコンオイルとしては、エポキシ、アルキル、ア ミノ、カルボキシル、アルコール、フッ素、アルキル・ アラルキル・ポリエーテル、エポキシ及びエポキシ・ポ リエーテル変性シリコンオイルが挙げられる。ポジ型レ 30 ジスト組成物の固形分中の塗布性改良剤の好ましい含有 **量は0.0001~10重量%であり、より好ましい含有量は0.** 001 ~ 1 重量%である。

【0013】アルカリ可溶性樹脂としては、例えばポリ ビニルフェノール、ポリイミド前駆体、ビニルフェノー ル共重合体等のビニル重合体、スチレンーマレイン酸共 重合体、当該スチレンーマレイン酸共重合体の部分エス テル体、無水マレイン酸ーメチルメタクリレート共重合 体、当該無水マレイン酸ーメチルメタクリレート共重合 体のエステル体、及びノボラック樹脂等が挙げられる。 40 ノボラック樹脂としては、例えばフェノール類とアルデ ヒド類とを縮合させて得られる樹脂が挙げられる。好ま しいフェノール類としては、例えばm-クレゾール、p **- クレゾール、2, 5 - キシレノール、3, 4 - キシレ** ノール、及び下式

[0014]

[化4]

特開平7-281018

HO
$$CH_3$$
 CH_3 (a)

【0015】で示される化合物等が挙げられる。好ましいアルデヒド類としては、例えばホルムアルデヒド等が挙げられる。好ましいビニル重合体としては、例えば下式

【0016】 【化5】

$$-cH_2 - cH_2 - cH_2 - cH_2 - cH_3$$

$$X_1 \longrightarrow X_5$$

$$X_2 \longrightarrow X_4$$

$$X_3 \longrightarrow X_4$$

【0017】(式中、Q1及びQ2は各々独立して水素原子又はアルキル基を表わし、Q1はアルキル、アリー 20ル、アルコキシ、ヒドロキシアルキルもしくはアルキルカルボニルオキシ基を表わし、X1~X5は各々独立して水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基又は水酸基を表わすが、X1~X5の中少なくとも1つは水酸基である。)で示される構造を含む重合体等が挙げられる。アルカリ可溶性樹脂は単独で、又は2種以上混合して用いられる。

[0018] 好ましいキノンジアジド化合物としては、例えばローナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステル、ローナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、サル及びローベンゾキノンジアジドスルホン酸エステル等が挙げられる。より好ましいキノンジアジド化合物としてはローナフトキノンジアジドスルホン酸エステルが挙げられる。これらのキノンジアジド化合物は半導体用ポジ型レジスト組成物に感光剤として添加されているものであり、その製造方法は公知である。本発明のポジ型レジスト組成物は前記化合物、アルカリ可溶性樹脂、キノンジアジド化合物及びレジスト溶剤に加えて、さらに架橋剤を含んでいてもよい。架橋剤としては上記アルカリ可溶性樹脂を熱又は酸により硬化させるものであればよく、特に制限されない。好ましい架橋剤としては、例えば下式

- (CH₂) ₀ OY

(式中、Yは水素原子又は低級アルキル基を表わし、uは $1\sim4$ の整数を表わす。) で示される基を有する化合物等が挙げられる。上式で示される基を有する化合物としては、例えば一般式(III)

[0019]

[化6]

$$\begin{array}{c|c}
Z \\
R_{10} > N \\
R_{11} \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
N \\
N \\
N \\
R_{11} \\
\end{array}$$
(III)

[0020] (式中、Zは-N(R₂₄)(R₂₅)又は置換されていてもよいアリール基を表わし、R₂₀~R₂₅は各々独立して水素原子又は上記-(CH₂)。OYを表 10 わす。〕で示される化合物、及び下式

[0021]

【化7】

[0022] で示される化合物等が挙げられる。これらの架橋剤は例えば特開平1-293339号公報等に記載された公知化合物である。架橋剤は単独で、又は2 種以上混合して用いられる。本発明のボジ型レジスト組成物は後述する光酸発生剤を含んでいてもよい。光酸発生剤としては光により直接もしくは間接的に酸を発生するものであればよく、特に制限されない。好ましい光酸発生剤としては、例えば、特開平4-163552号公報に記載されているトリハロメチルトリアジン系化合物、特開平1-57777号公報に記載されているジスルホン化合物、下式 $0_4-S0_2-S0_2-Q_5-S0_2-Q_5$

(式中、Q₄及びQ₆は各々独立して置換されていてもよい アリール、アラルキル、アルキル、シクロアルキル又は 複素環基を表わし、Q₆は置換されていてもよいアリール 基を表わす。)で示される化合物、特開平1-293339号 公報に配載されているスルホン酸エステル基を含む光酸 発生剤、下式

CF₃-SO₂ O-(CH₂)₄ -Y₀

(式中、 Y_0 は置換されていてもよいアリール基を表わし、dは0 又は1 を表わす。) で示される化合物、下式 CP_3 $-SO_2$ 0 $-[C(Y_1)(Y_2)]_6$ -C(0) $-Y_3$

(式中、Y1及びY2は各々独立して置換されていてもよい アリール、アルキル又はアルコキシ基を表わし、Y3は置 50 換されていてもよいアリール基を表わし、eは1又は2

を表わす。)で示される化合物、下式 $CF_8 - SO_2 O - N(Y_4) - C(O) - Y_5$

(式中、Y4は置換されていてもよいアルキル基を表わ し、Y6 は置換されていてもよいアリール基を表わす。) で示される化合物、下式

 $CF_8 - SO_2 O - N = C(Y_6)(Y_7)$

(式中、Y6は水素原子又は置換されていてもよいアリー ルもしくはアルキル基を表わし、Ynは置換されていても よいアリール基を表わす。)で示される化合物、下式 [0023]

(化8)

$$\bigcirc -1^{+}-\bigcirc \cdot BF_{q}^{-} \qquad \bigcirc -1^{+}-\bigcirc \cdot PF_{q}^{-}$$

$$\bigcirc -1^{+}-\bigcirc \cdot CF_{q}SO_{q}^{-} \qquad CH_{q}O -\bigcirc \cdot 1^{+}-\bigcirc \cdot S_{q}F_{q}^{-}$$

$$\bigcirc -1^{+}-\bigcirc \cdot CF_{q}SO_{q}^{-} \qquad CH_{q}O -\bigcirc \cdot 1^{+}-\bigcirc \cdot S_{q}F_{q}^{-}$$

$$\bigcirc -1^{+}-\bigcirc \cdot CF_{q}SO_{q}^{-} \qquad CH_{q}O -\bigcirc \cdot 1^{+}-\bigcirc \cdot S_{q}F_{q}^{-}$$

$$\bigcirc -1^{+}-\bigcirc \cdot CF_{q}SO_{q}^{-} \qquad CH_{q}O -\bigcirc \cdot 1^{+}-\bigcirc \cdot S_{q}F_{q}^{-}$$

$$\bigcirc -1^{+}-\bigcirc \cdot CF_{q}SO_{q}^{-} \qquad CH_{q}O -\bigcirc \cdot 1^{+}-\bigcirc \cdot S_{q}F_{q}^{-}$$

$$\bigcirc -1^{+}-\bigcirc \cdot CF_{q}SO_{q}^{-} \qquad CH_{q}O -\bigcirc \cdot 1^{+}-\bigcirc \cdot S_{q}F_{q}^{-}$$

$$\bigcirc -1^{+}-\bigcirc \cdot CF_{q}SO_{q}^{-} \qquad CH_{q}O -\bigcirc \cdot 1^{+}-\bigcirc \cdot S_{q}F_{q}^{-}$$

【0024】で示されるオニウム塩等が挙げられる。ポ リ可溶性樹脂、キノンジアジド化合物、架橋剤及び光酸 発生剤の好ましい使用量は、レジスト溶剤中に各々1~ 50、1~50、1~50、0~30及び0~30重量%である。 露光に用いられる好ましい照射線としては、例えば紫外 線及び遠紫外線等が挙げられる。

[0025]

【0029】で示される酸性染料〔住友化学工業(株) 製スミノール ミリング イエローMRJ 20g 、塩化チオ 二ル100ml 及びジメチルホルムアミド15g の混合物を還 流条件で30分反応させた後、得られた反応混合物を氷水 中に注いだ。析出したスルホニルクロリドを濾過後、洗 浄及び乾燥後、1,5-ジメチルヘプチルアミンとテト ラヒドロフラン中で反応 (モル比1:2) させてイエロ - 色素 (λ * * * * = 約410nm (ジメチルホルムアミド 40 中)〕を得た。

【0030】合成例2~5

下式

[0031]

【化10】

* 【発明の効果】本発明のポジ型レジスト組成物ではレジ スト溶剤が、水素原子が1個置換されたスルホンアミド 基を有する化合物を良く溶解するので上記化合物を高濃 **度で含有させることができ、又、前配化合物が色素であ** ってもその経時安定性に優れている。従って、上記レジ スト組成物は色濃度、微細度及び色調等の性能に優れて いる。

[0026]

【実施例】次に実施例を挙げて本発明をより具体的に説 10 明する。例中、部は重量部を示す。尚、参考例における 共通の条件は以下のとおりである。カラーフィルターを 製造する際、シリコンウエハー又は石英ガラスウエハー に色素、キノンジアジド化合物、アルカリ可溶性樹脂及 び溶剤等を含むレジスト組成物をスピンコートし、加熱 して有機溶剤を蒸発させた後、マスクを通して露光を行 い、次いで現像してモザイクパターンを得た〔露光は二 コン社製i線露光ステッパーNIKON NSR(NA=0.50) によ り行った。又、アルカリ性現像液は住友化学工業(株) 製SOPD又は3%テトラメチルアンモニウムハイドロオキ ジ型レジスト組成物の固形分である前記化合物、アルカ 20 サイド水溶液を用いた〕。さらに、ポジ型パターンを全 面露光後、加熱 (180 ℃、20分) してカラーフィルター を得た。

[0027] 合成例1

下式

[0028]

【化9】

HNHCH(CH₃)CH₂CH₂CH₂CH(CH₃)₂

HNHCH2CH2CH2OCH2CH3

HNHCH(CH3)CH2CH2CH2CH2CH2CH3

HNHCH(CH3)CH2CH(CH3)CH3

【0032】で示される1級アミンを各々用いる以外 は、合成例1と同様にしてイエロー色素を各々得た。

【0033】 実施例1

合成例1で得たイエロー色素0.8 部、m-クレゾール/ p-クレゾール/ホルムアルデヒド(モル比50/50/7 5) 混合物から得られたクレゾールノボラック樹脂1 部、下式

50 [0034]

10

【化11】

9

【0035】で示されるフェノール化合物のローナフト 水酸基がエステル化されている) 0.8 部、ヘキサメトキ シメチロール化メラミン0.3 部、1%ポリエーテル変性 シリコンオイル (東レシリコン社製SH-8400) 乳酸エチ ル溶液0.06部、ジメチルホルムアミド0.7 部及び乳酸エ チル9.5 部の混合物をメンプランフィルターを用いて加 圧濾過してポジ型レジスト組成物を得た。前記ウエハー 上に上記レジスト組成物をパターニングして得たカラー フィルターは蒋膜 $(0.6~\mu\,\text{m})$ でも色濃度が濃く、色 調、微細度及びパターン形状等の賭性能に優れていた。

[0036] 実施例2~5

合成例1で得たイエロー色素に代えて合成例2~5で得

たイエロー色素を用いる以外は、実施例1と同様にして レジスト組成物及びカラーフィルターを得た。これらの カラーフィルターは実施例1と同様の性能を有してい た。

【0037】 実施例6

m-クレゾール/p-クレゾール/ホルムアルデヒド (モル比50/50/75) 混合物から得られたクレゾールノ ポラック樹脂1部に代えて前配化4で示される化合物 (a) 及びホルムアルデヒド (モル比95/100) 混合物か キノンジアジドー 5 - スルホン酸エステル(平均 2 個の 10 ら得られたノボラック樹脂0.3 部並0にマルカリンカー CST-70 (丸善石油 (株) 製のスチレンーピニルフェノー ル共重合体〕0.7 部の混合樹脂を用いる以外は、実施例 1と同様にしてレジスト組成物及びカラーフィルターを 得た。このカラーフィルターは実施例1と同様の性能を 有していた。

[0038] 実施例7

合成例1で得たイエロー色素に代えてオレオゾールファ ストブルーRL(田岡化学(株)製の銅フタロシアニン染 料〕を用いる以外は、実施例6と同様にしてポジ型レジ 20 スト組成物及びカラーフィルターを得た。このカラーフ ィルターは実施例1と同様の性能を有していた。